

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁴
G11B 5/72

(11) 공개번호 특1987-0010492
(43) 공개일자 1987년11월30일

(21) 출원번호	특1987-0003571
(22) 출원일자	1987년04월14일
(30) 우선권주장	84966 1986년04월15일 일본(JP) 127644 1986년06월02일 일본(JP) 217216 1986년09월17일 일본(JP) 227988 1986년09월19일 일본(JP) 234459 1986년10월03일 일본(JP)
(71) 출원인	후루가와 텡기 고교 가부시기가이샤 구사가베 엡지 일본국 도쿄도 지요다구 마루노우찌 2-6-1
(72) 발명자	시이 하가루 일본국 도쿄도 오오다구 미나미 센조구 1-3-1-406 가네야 야스히로 일본국 도쿄도 시나가와구 후다바 1-12-18 니시모도 다구야 일본국 가나가와현 요코하마시 미도리구 가모이 1-16-2-604
(74) 대리인	손은진

심사청구 : 없음

(54) 자기기록 미이디엄 및 그 제조방법

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

자기기록 미이디엄 및 그 제조방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 승화성 유기 화합물이 반응실 내부에서 증발되는 경우의 본 발명에 일치하는 자기기록 미이디엄을 제조하는 실예를 설명하기 위한 개략도.

제2도는 증발된 승화성 유기 화합물이 반응실 외부에서 반응실 내부로 유도되는 경우의 본 발명에 일치하는 자기기록 미이디엄을 제조하는 실예를 설명하기 위한 개략도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1

자기기록 미이디엄을 구성하기 위해 접착기면상에 얇은 강자성 금속필름을 형성하는 자기기록 미이디엄에 있어서 보호피막은 롬 온도 및 대기압하에서 고체 상태를 나타내는 증발된 승화성 유기 화합물의 플라즈마 중합에 의하여 상기 얇은 강자성 필름상에 형성된 것을 특징으로 하는 자기기록 미이디엄.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 승화성 유기 화합물은 나프탈렌, 안트라센, 테트라센, 헥사센, 페틸렌, 펜안트렌, 크리센, 트리페닐렌, 피렌, 벤조피렌, 바이오탄트렌, 푸로넨, 또는 오발렌과 같은 방향족탄화수소와; 방향족 탄화수소의 유도체와; 디페닐, 디페닐메탄, 디벤질, 트리페닐메탄, 또는 테트페닐과 같은 지방족-

방향족 탄화수소와 ; 지방족-방향족 탄화수소 등으로 구성되는 군으로부터 선택된 최소한 하나의 화합물인 것을 특징으로 하는 자기기록 미이디엄.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 보호피막은 승화성 유기 화합물로서 디벤질 내지 디페닐을 사용하는 플라즈마 중합 필름이며, 0.8에서 1.2까지의 수소 원자수에 탄소원자수의 비(H/C)를 가지며, 50에서 600Å의 필름 두께를 가지는 것을 특징으로 하는 자기기록 미이디엄.

청구항 4

접착기면에 형성된 얇은 강자성 금속 필름으로 구성된 자기 녹음층의 표면에 보호피막을 형성하는 자기기록 미이디엄을 제조하는 방법에 있어서, 상기 보호피막을 롬 온도와 대기압하에서 고체 상태를 나타내는 증발된 승화성 유기 화합물의 플라즈마 중합에 의하여 형성되며, 그 뒤 최종 자기기록 미이디엄은 열처리를 받는 것을 특징으로 하는 자기기록 미이디엄 제조방법.

청구항 5

제4항에 있어서, 열처리는 외부공기, 불활성 가스, 또는 진공 환경내에서 50에서 300℃의 가열은 도로 수행되는 것을 특징으로 하는 자기기록 미이디엄 제조방법.

청구항 6

제4항에 있어서, 열처리는 산소, 수소, 질소와 같은 것으로 구성되는 군으로부터 선택된 최소한 하나의 기체를 포함하는 반응 매체 환경내에서 50에서 300℃의 가열온도로 수행되는 것을 특징으로 하는 자기기록 미이디엄 제조방법.

청구항 7

접착기면에 형성된 얇은 강자성 금속 필름으로 구성된 자기 녹음층의 표면에 보호피막을 형성하는 자기기록 미이디엄을 제조하는 방법에 있어서, 상기 보호피막은 상기 접착기면을 가열하는 동안 롬 온도와 대기압하에서 고체 상태를 나타내는 증발된 승화성 유기 화합물의 플라즈마 중합에 의해 상기 얇은 강자성 금속필름의 표면에 형성되는 것을 특징으로 하는 자기기록 미이디엄 제조방법.

청구항 8

제7항에 있어서, 상기 접착기면은 50에서 300℃까지의 범위내의 온도로 가열되는 것을 특징으로하는 자기기록 미이디엄 제조방법.

청구항 9

접착기면에 형성된 얇은 강자성 금속필름으로 구성된 자기녹음층의 표면에 보호피막을 형성하는 자기기록 미이디엄을 제조하는 방법에 있어서, 상기 보호피막은 상기 접착기면을 가열하는 동안 롬 온도와 대기압하에서 고체 상태를 나타내는 증발된 승화성 유기 화합물의 플라즈마 중합에 의해 상기 얇은 강자성 금속필름의 표면에 형성되며, 그 뒤 최종자기 기록 미이디엄은 열처리를 받는 것을 특징으로 하는 자기기록 미이디엄 제조방법.

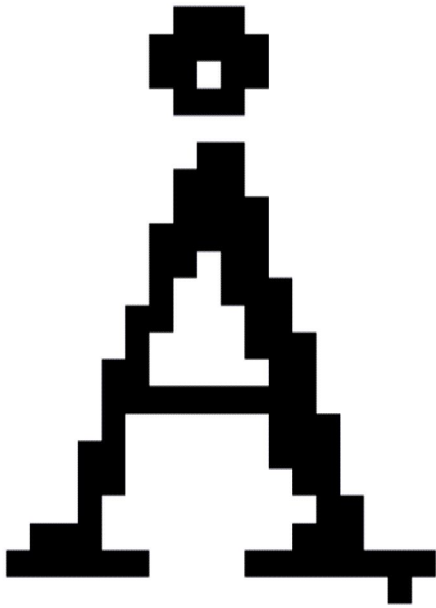
청구항 10

접착기면에 형성된 강자성 금속필름으로 구성된 자기 녹음층의 표면에 보호피막을 형성하는 자기기록 미이디엄을 제조하는 방법에 있어서, 상기 보호피막은, 밀폐실내에서 가열되어 증발된 다음 플라즈마 중합 반응실로 유도되고 롬 온도와 대기압하에서 고체상태를 나타내는 증발된 승화유기화합물의 플라즈마 중합에 의해 상기 얇은 강자성 금속필름의 표면에 형성되는 것을 특징으로 하는 자기기록 미이디엄 제조방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



도면2

